



KINTEK FURNACE

Cvd & Pecvd Furnace Catálogo

Contact us for more catalogs of [High Temperature Furnaces](#), etc.

KINTEK FURNACE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Sistema Rf Pecvd Deposición Química En Fase Vapor Mejorada Con Plasma Por Radiofrecuencia

Número de artículo: KT-RFPE



Introducción

Sistema PECVD RF KINTEK: Deposición de película fina de precisión para semiconductores, óptica y MEMS. Proceso automatizado a baja temperatura con película de calidad superior. Soluciones personalizadas disponibles.

[Aprende más](#)

Forma del equipo	<ul style="list-style-type: none"> Tipo caja: la cubierta superior horizontal abre la puerta, y la cámara de deposición y la cámara de escape están soldadas integralmente; Toda la máquina: el motor principal y el armario de control eléctrico tienen un diseño integrado (la cámara de vacío está a la izquierda, y el armario de control eléctrico está a la derecha).
Cámara de vacío	<ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: $\Phi 420\text{mm}$ (diámetro) $\times 400\text{ mm}$ (altura); hecha de acero inoxidable SUS304 de alta calidad 0Cr18Ni9, la superficie interior está pulida, se requiere mano de obra fina sin juntas de soldadura ásperas, y hay tuberías de agua de refrigeración en la pared de la cámara; Puerto de extracción de aire: Malla de acero inoxidable 304 de doble capa con intervalos delanteros y traseros de 20 mm, deflector antiincrustante en el vástago alto de la válvula, y placa de eculización de aire en la boca del tubo de escape para evitar la contaminación; Método de sellado y blindaje: la puerta de la cámara superior y la cámara inferior están selladas por un anillo de sellado para sellar el vacío, y el tubo de red de acero inoxidable se utiliza en el exterior para aislar la fuente de radiofrecuencia, blindando el daño causado por las señales de radiofrecuencia a las personas; Ventana de observación: Dos ventanas de observación de 120 mm están instaladas en la parte frontal y lateral, y el vidrio antiincrustante es resistente a altas temperaturas y radiación, lo cual es conveniente para observar el sustrato; Modo de flujo de aire: el lado izquierdo de la cámara es bombeado por la bomba molecular, y el lado derecho es el aire inflado para formar un modo de trabajo convectivo de carga y bombeo para asegurar que el gas fluye uniformemente a la superficie objetivo y entra en el área de plasma para ionizar completamente y depositar la película de carbono; Material de la cámara: el cuerpo de la cámara de vacío y el puerto de escape están hechos de material de acero inoxidable SUS304 0Cr18Ni9 de alta calidad, la cubierta superior está hecha de aluminio de alta pureza para reducir el peso de la parte superior.
Esqueleto de la cámara	<ul style="list-style-type: none"> Fabricado en acero perfilado (material: Q235-A) , el cuerpo de la cámara y el armario de control eléctrico tienen un diseño integrado.
Sistema de refrigeración por agua	<ul style="list-style-type: none"> Tuberías: Las tuberías principales de entrada y salida de distribución de agua están hechas de tubos de acero inoxidable; Válvula de bola: Todos los componentes de refrigeración se suministran con agua por separado a través de válvulas de bola 304, y las tuberías de entrada y salida de agua tienen distinciones de color y señales correspondientes, y las válvulas de bola 304 para las tuberías de salida de agua se pueden abrir y cerrar por separado; El objetivo, la fuente de alimentación de RF, la pared de la cámara, etc. están equipados con protección de flujo de agua, y hay una alarma de corte de agua para evitar que la tubería de agua se bloquee. Todas las alarmas de flujo de agua se muestran en el ordenador industrial; Visualización del flujo de agua: El objetivo inferior tiene monitorización de flujo de agua y temperatura, y la temperatura y el flujo de agua se muestran en el ordenador industrial ; Temperatura del agua fría y caliente: cuando la película se deposita en la pared de la cámara, se pasa agua fría 10-25 grados para enfriar el agua, y se avanza cuando se abre la puerta de la cámara. Pasar agua caliente 30-55 grados agua caliente.
Armario de control	<ul style="list-style-type: none"> Estructura: se adoptan armarios verticales, el armario de instalación de instrumentos es un armario de control estándar internacional de 19 pulgadas, y el otro armario de instalación de componentes eléctricos es una estructura de panel grande con puerta trasera; Panel: Los principales componentes eléctricos del armario de control se seleccionan todos de fabricantes que han pasado la certificación CE o la certificación ISO9001. Instale un conjunto de tomas de corriente en el panel; Método de conexión: el armario de control y el anfitrión están en una estructura conjunta, el lado izquierdo es el cuerpo de la sala, el lado derecho es el armario de control, y la parte inferior está equipada con una ranura dedicada para cables, alta y baja tensión, y la señal de RF está separada y enrutada para reducir las interferencias; Eléctrico de baja tensión: Interruptor neumático francés Schneider y contactor para garantizar una alimentación fiable de los equipos; Tomas de corriente: En el armario de control se han instalado tomas de repuesto y tomas de instrumentación.

Vacío final	<ul style="list-style-type: none"> • Atmósfera a 2×10^{-4} Pa \leq 24 horas, (a temperatura ambiente, y la cámara de vacío está limpia).
Tiempo de restablecimiento del vacío	<ul style="list-style-type: none"> • Atmósfera a 3×10^{-3} Pa \leq 15 min (a temperatura ambiente, y la cámara de vacío está limpia, con deflectores, paragüeros, y sin sustrato).
Velocidad de aumento de la presión	<ul style="list-style-type: none"> • $\leq 1,0 \times 10^{-1}$ Pa/h
Configuración del sistema de vacío	<ul style="list-style-type: none"> • Composición del conjunto de bombas: bomba de respaldo BSV30 (Ningbo Boss) + bomba de raíces BSJ70 (Ningbo Boss) + bomba molecular FF-160 (Pekín); • Método de bombeo: bombeo con dispositivo de bombeo suave (para reducir la contaminación del sustrato durante el bombeo); • Conexión de tuberías: la tubería del sistema de vacío es de acero inoxidable 304, y la conexión suave de la tubería es de; • Fuelle metálico; cada válvula de vacío es una válvula neumática; • Puerto de succión de aire: Para evitar que el material de la membrana contamine la bomba molecular durante el proceso de evaporación y mejorar la eficiencia de bombeo, se utiliza una placa de aislamiento móvil que es fácil de desmontar y limpiar entre el puerto de succión de aire del cuerpo de la cámara y la sala de trabajo.
Medición del sistema de vacío	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador de vacío: tres bajos y un alto (3 grupos de regulación ZJ52 + 1 grupo de regulación ZJ27); • Medidor de alto vacío: El medidor de ionización ZJ27 está instalado en la parte superior de la cámara de bombeo de la caja de vacío cerca de la cámara de trabajo, y el rango de medición es de $1,0 \times 10^{-1}$ Pa a $5,0 \times 10^{-5}$ Pa; • Medidores de bajo vacío: un juego de medidores ZJ52 se instala en la parte superior de la cámara de bombeo de la caja de vacío, y el otro juego se instala en el tubo de bombeo en bruto. El rango de medición es de $1,0 \times 10^{+5}$ Pa a $5,0 \times 10^{-1}$ Pa; • Regulación de trabajo: El medidor capacitivo de película CDG025D-1 se instala en el cuerpo de la cámara, y el rango de medición es de $1,33 \times 10^{-1}$ Pa a $1,33 \times 10^{+2}$ Pa, detección de vacío durante la deposición y el recubrimiento, se utiliza junto con el uso de la válvula de mariposa de vacío constante.
Funcionamiento del sistema de vacío	<p>Hay dos modos de selección de vacío manual y automático;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Japón Omron PLC controla todas las bombas, la acción de la válvula de vacío, y la relación de enclavamiento entre el trabajo de la válvula de parada de inflación para asegurar que el equipo puede ser protegido automáticamente en caso de mal funcionamiento; • Válvula alta, válvula baja, pre-válvula, válvula de derivación de válvula alta, la señal en posición se envía a la señal de control del PLC para asegurar una función de enclavamiento más completa; • El programa PLC puede llevar a cabo la función de alarma de cada punto de fallo de toda la máquina, como la presión de aire, el flujo de agua, la señal de la puerta, la señal de protección de sobrecorriente, etc. y la alarma, de modo que el problema se puede encontrar de forma rápida y cómoda; • La pantalla táctil de 15 pulgadas es el ordenador superior, y el PLC es el ordenador inferior de monitorización y control de la válvula. Monitoreo en línea de cada componente y varias señales se envían de vuelta al software de configuración de control industrial en el tiempo para el análisis y el juicio, y se registran; • Cuando el vacío es anormal o se corta la corriente, la bomba molecular de la válvula de vacío debe volver al estado cerrado. La válvula de vacío está equipada con una función de protección de enclavamiento, y la entrada de aire de cada cilindro está equipado con un dispositivo de ajuste de la válvula de corte, y hay una posición establecer el sensor para mostrar el estado cerrado del cilindro;
Prueba de vacío	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo con las condiciones técnicas generales de la máquina de recubrimiento al vacío GB11164.

Horno Tubular Cvd De Cámara Partida Con Estación De Vacío Máquina Cvd

Número de artículo: KT-CTF12



Introducción

Horno tubular CVD de cámara partida con estación de vacío - Horno de laboratorio de 1200°C de alta precisión para la investigación de materiales avanzados. Soluciones personalizables disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo de horno	KT-CTF12-60
Temperatura máxima	1200°C
Temperatura de trabajo constante	1100°C
Material del tubo del horno	Cuarzo de alta pureza
Diámetro del tubo del horno	60mm
Longitud de la zona de calentamiento	1x450mm
Material de la cámara	Fibra de alúmina japonesa
Elemento calefactor	Bobina de alambre Cr2Al2Mo2
Velocidad de calentamiento	0-20°C/min
Par térmico	Tipo K incorporado
Regulador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil
Precisión del control de temperatura	±1°C
Distancia de deslizamiento	600mm
Unidad de control preciso de gas	
Caudalímetro	Caudalímetro másico MFC
Canales de gas	4 canales
Caudal	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM CH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
Linealidad	±0,5% F.S.
Repetibilidad	±0,2% E.F.
Tubería y válvula	Acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento	0,45MPa
Controlador del caudalímetro	Controlador de perilla digital/Controlador de pantalla táctil
Unidad de vacío estándar (opcional)	
Bomba de vacío	Bomba de vacío rotativa de paletas

Caudal de la bomba	4L/S
Boca de aspiración de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro de silicón Pirani/Resistance
Presión nominal de vacío	10Pa
Unidad de alto vacío (opcional)	
Bomba de vacío	Bomba rotativa de paletas+Bomba molecular
Caudal de la bomba	4L/S+110L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro compuesto
Presión de vacío nominal	6x10 ⁻⁵ Pa
Las especificaciones y configuraciones anteriores pueden personalizarse	

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Tubo de cuarzo	1
3	Brida de vacío	2
4	Bloque térmico del tubo	2
5	Gancho bloque térmico tubo	1
6	Guante resistente al calor	1
7	Control preciso del gas	1
8	Unidad de vacío	1
9	Manual de instrucciones	1

Máquina De Horno De Tubo Cvd De Múltiples Zonas De Calentamiento Para Equipos De Deposición Química De Vapor

Número de artículo: KT-CTF14



Introducción

Los hornos tubulares CVD multizona de KINTEK ofrecen un control preciso de la temperatura para la deposición avanzada de películas finas. Ideales para investigación y producción, personalizables según las necesidades de su laboratorio.

[Aprende más](#)

Modelo de horno	KT-CTF14-60
Temperatura máxima	1400°C
Temperatura de trabajo constante	1300°C
Material del tubo del horno	Tubo de Al ₂ O ₃ de alta pureza
Diámetro del tubo del horno	60mm
Zona de calentamiento	2x450mm
Material de la cámara	Fibra policristalina de alúmina
Elemento calefactor	Carburo de silicio
Velocidad de calentamiento	0-10°C/min
Par térmico	Tipo S
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil
Precisión del control de temperatura	±1°C
Unidad de control preciso de gas	
Caudalímetro	Caudalímetro másico MFC
Canales de gas	4 canales
Caudal	MFC1: 0-5SCCM O ₂ MFC2: 0-20SCMCH ₄ MFC3: 0- 100SCCM H ₂ MFC4: 0-500 SCCM N ₂
Linealidad	±0,5% F.S.
Repetibilidad	±0,2% E.F.
Tubería y válvula	Acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento	0,45MPa
Controlador del caudalímetro	Controlador de perilla digital/Controlador de pantalla táctil
Unidad de vacío estándar (opcional)	
Bomba de vacío	Bomba de vacío rotativa de paletas
Caudal de la bomba	4L/S

Puerto de succión de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro de silicona Pirani/Resistance
Presión nominal de vacío	10Pa
Unidad de alto vacío (opcional)	
Bomba de vacío	Bomba rotativa de paletas+Bomba molecular
Caudal de la bomba	4L/S+110L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro compuesto
Presión de vacío nominal	6x10 ⁻⁵ Pa

Las especificaciones y configuraciones anteriores pueden personalizarse

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Tubo de cuarzo (u otro material según pedido)	1
3	Juego de bridas de vacío	2
4	Bloque térmico del tubo	2
5	Gancho bloque térmico tubo	1
6	Guante resistente al calor	1
7	Unidad de control de gas de precisión (si se ha pedido)	1
8	Unidad de vacío (si se pide)	1
9	Manual de instrucciones	1

Horno De Tubo Cvd Versátil Hecho A Medida Equipo De Deposición Química De Vapor Cvd Máquina

Número de artículo: KT-CTF16



Introducción

El horno tubular CVD de KINTEK ofrece un control preciso de la temperatura hasta 1600°C, ideal para la deposición de películas finas. Personalizable para necesidades de investigación e industriales.

[Aprende más](#)

Modelo de horno	KT-CTF16-60
Temperatura máxima	1600°C
Temperatura de trabajo constante	1550°C
Material del tubo del horno	Tubo de Al ₂ O ₃ de alta pureza
Diámetro del tubo del horno	60mm
Zona de calentamiento	3x300mm
Material de la cámara	Fibra policristalina de alúmina
Elemento calefactor	Carburo de silicio
Velocidad de calentamiento	0-10°C/min
Par térmico	Tipo S
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil
Precisión del control de temperatura	±1°C
Unidad de control preciso de gas	
Caudalímetro	Caudalímetro másico MFC
Canales de gas	3 canales (personalizables)
Caudal (Ejemplo)	MFC1: 0-5SCCM O ₂ MFC2: 0-20SCCM CH ₄ MFC3: 0- 100SCCM H ₂ MFC4: 0-500 SCCM N ₂ (personalizable)
Linealidad	±0,5% F.S.
Repetibilidad	±0,2% E.F.
Tubería y válvula	Acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento	0,45MPa
Controlador del caudalímetro	Controlador de perilla digital/Controlador de pantalla táctil
Unidad de vacío estándar (opcional)	
Bomba de vacío	Bomba de vacío rotativa de paletas
Caudal de la bomba	4L/S

Boca de aspiración de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro de silicona Pirani/Resistance
Presión nominal de vacío	10Pa
Unidad de alto vacío (opcional)	
Bomba de vacío	Bomba rotativa de paletas+Bomba molecular
Caudal de la bomba	4L/S+110L/S
Boca de aspiración de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro compuesto
Presión de vacío nominal	6x10-5Pa

Las especificaciones y configuraciones anteriores pueden personalizarse

No.	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo del horno con control de temperatura	1
2	Tubo de alúmina de alta pureza o cuarzo (según pedido)	1
3	Bridas de sellado al vacío con puertos	2 juegos
4	Bloques/Tapones Térmicos de Tubo	2
5	Tubo Bloque Térmico Gancho	1
6	Guantes resistentes al calor	1 par
7	Unidad de control de gas precisa (MFC según pedido)	1 juego
8	Unidad de vacío (bomba y manómetro según pedido)	1 juego
9	Manual de instrucciones	1

Horno Tubular Pecvd Deslizante Con Gasificador Líquido

Máquina Pecvd

Número de artículo: KT-PE12



Introducción

Horno tubular KINTEK Slide PECVD: deposición de película fina de precisión con plasma RF, ciclos térmicos rápidos y control de gas personalizable. Ideal para semiconductores y células solares.

[Aprende más](#)

Modelo de horno	KT-PE12-60
Temperatura máxima	1200°C
Temperatura de trabajo constante	1100°C
Material del tubo del horno	Cuarzo de alta pureza
Diámetro del tubo del horno	60mm
Longitud de la zona de calentamiento	1x450mm
Material de la cámara	Fibra de alúmina japonesa
Elemento calefactor	Bobina de alambre Cr2Al2Mo2
Velocidad de calentamiento	0-20°C/min
Par térmico	Tipo K incorporado
Regulador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil
Precisión del control de temperatura	±1°C
Distancia de deslizamiento	600mm
Unidad de plasma RF	
Potencia de salida	5 -500W ajustable con ± 1% de estabilidad
Frecuencia RF	13,56 MHz ±0,005% de estabilidad
Potencia de reflexión	350W máx.
Adaptación	Automática
Ruido	
Refrigeración	Refrigeración por aire.
Unidad de control preciso de gas	
Caudalímetro	Caudalímetro másico MFC
Canales de gas	4 canales
Caudal	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2

Linealidad	±0,5% F.S.
Repetibilidad	±0,2% E.F.
Tubería y válvula	Acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento	0,45MPa
Controlador del caudalímetro	Controlador de perilla digital/Controlador de pantalla táctil

Unidad de vacío estándar (opcional)

Bomba de vacío	Bomba de vacío rotativa de paletas
Caudal de la bomba	4L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro de silicona Pirani/Resistance
Presión nominal de vacío	10Pa

Unidad de alto vacío (opcional)

Bomba de vacío	Bomba rotativa de paletas+Bomba molecular
Caudal de la bomba	4L/S+110L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro compuesto
Presión de vacío nominal	6x10 ⁻⁴ Pa

Las especificaciones y configuraciones anteriores pueden personalizarse

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Tubo de cuarzo	1
3	Brida de vacío	2
4	Bloque térmico del tubo	2
5	Gancho bloque térmico tubo	1
6	Guante resistente al calor	1
7	Fuente de plasma de RF	1
8	Control preciso del gas	1
9	Unidad de vacío	1
10	Manual de instrucciones	1

Máquina De Horno Tubular Inclinado De Deposición Química Mejorada Por Plasma Pecvd

Número de artículo: KT-PE16



Introducción

Horno tubular PECVD avanzado para la deposición precisa de películas finas. Calentamiento uniforme, fuente de plasma RF, control de gas personalizable. Ideal para la investigación de semiconductores.

[Aprende más](#)

Modelo de horno	PE-1600-60
Temperatura máxima	1600°C
Temperatura de trabajo constante	1550°C
Material del tubo del horno	Tubo de Al ₂ O ₃ de alta pureza
Diámetro del tubo del horno	60mm
Longitud de la zona de calentamiento	2x300mm
Material de la cámara	Fibra de alúmina japonesa
Elemento calefactor	Disilicida de molibdeno
Velocidad de calentamiento	0-10°C/min
Par térmico	Tipo B
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil
Precisión del control de temperatura	±1°C
Unidad de plasma RF	
Potencia de salida	5 -500W ajustable con ± 1% de estabilidad
Frecuencia RF	13,56 MHz con ±0,005% de estabilidad
Potencia de reflexión	350W máx.
Adaptación	Automática
Ruido	<50 dB
Refrigeración	Refrigeración por aire
Unidad de control preciso de gas	
Caudalímetro	Caudalímetro másico MFC
Canales de gas	4 canales
Caudal	MFC1: 0-5SCCM O ₂ MFC2: 0-20SCCM CH ₄ MFC3: 0- 100SCCM H ₂ MFC4: 0-500 SCCM N ₂
Linealidad	±0,5% F.S.

Repetibilidad	±0,2% E.F.
Tubería y válvula	Acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento	0,45MPa
Controlador del caudalímetro	Controlador de perilla digital/Controlador de pantalla táctil
Unidad de vacío estándar (opcional)	
Bomba de vacío	Bomba de vacío rotativa de paletas
Caudal de la bomba	4L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro de silicona Pirani/Resistance
Presión nominal de vacío	10Pa
Unidad de alto vacío (opcional)	
Bomba de vacío	Bomba rotativa de paletas+Bomba molecular
Caudal de la bomba	4L/S+110L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Vacuómetro	Vacuómetro compuesto
Presión de vacío nominal	6x10-5Pa
Las especificaciones y configuraciones anteriores pueden personalizarse	

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Tubo de cuarzo	1
3	Brida de vacío	2
4	Bloque térmico del tubo	2
5	Gancho bloque térmico tubo	1
6	Guante resistente al calor	1
7	Fuente de plasma de RF	1
8	Control preciso del gas	1
9	Unidad de vacío	1
10	Manual de instrucciones	1

Máquina De Horno Tubular Inclinado De Deposición Química Mejorada Por Plasma Pecvd

Número de artículo: KT-PED



Introducción

La máquina de recubrimiento PECVD de KINTEK proporciona películas finas de precisión a bajas temperaturas para LED, células solares y MEMS. Soluciones personalizables de alto rendimiento.

[Aprende más](#)

Soporte de muestras	Tamaño	1-6 pulgadas
	Velocidad de rotación	0-20rpm ajustable
	Temperatura de calentamiento	≤800°C
	Precisión de control	±0,5°C Controlador PID SHIMADEN
Purga de gas	Medidor de caudal	CONTROLADOR DE CAUDALÍMETRO MÁSIKO (MFC)
	Canales	4 canales
	Método de refrigeración	Refrigeración por agua circulante
Cámara de vacío	Tamaño de la cámara	Φ500mm X 550mm
	Puerto de observación	Puerto de visión completa con deflector
	Material de la cámara	Acero inoxidable 316
	Tipo de puerta	Puerta de apertura frontal
	Material de la tapa	Acero inoxidable 304
	Puerto de la bomba de vacío	Brida CF200
	Puerto de entrada de gas	φ6 Conector VCR
Potencia de plasma	Fuente de alimentación	Alimentación CC o RF
	Modo de acoplamiento	Acoplado inductivamente o capacitivo de placa
	Potencia de salida	500W-1000W
	Potencia de polarización	500v
Bomba de vacío	Prebomba	Bomba de vacío de paletas 15L/S
	Puerto de la bomba turbo	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Puerto de alivio	KF25
	Velocidad de la bomba	Bomba de paletas:15l/s[Bomba turbo:1200l/s]1600l/s
	Grado de vacío	≤5×10-5Pa
	Sensor de vacío	Medidor de vacío de ionización/resistencia/medidor de película
Sistema	Alimentación eléctrica	CA 220V /380 50Hz

Potencia nominal	5kW
Dimensiones	900mm X 820mm X870mm
Peso	200kg

Kintek Furnace

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China
Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong
Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

WhatsApp or type unknown